KANTO CHEMICAL CO., IN	C.				Cicc	
CHEMICAL	Ţ	Ĵ			ES	
2013 No.4 (通巻230号)					ISSN 0285-2446	
ー 含フッ素化合物を用いたナノインプリントリソグラフィ用離型材料の開発	山下	恒雄	森田	正道		2
マイクロ波加熱の化学反応への適用:貴金属ナノ粒子の合成	國井	勝之	和田	雄二		7

12

19

24

 新・私の古生物誌(10)
 生きている化石ヘラチョウザメー
 福田 芳生

 ViewaBlue® Stain KANTO染色によるアガロースゲルからのDNA回収における問題点の解消
 高橋 宏和 松本 敦子 金原 浩子 杉山 滋 小堀 俊郎 山嵜 裕之 千室 智之 小林 崇良

最近のトピックス



含フッ素化合物を用いた ナノインプリントリソグラフィ用離型材料の開発

Novel Fluorinated Compounds as Release Materials in Nanoimprint Lithography

ダイキン工業株式会社 化学研究開発センター 研究員 山下 恒雄 TSUNE YAMASHITA 主任研究員 森田 正道 MASAMICHI MORITA Chemical R&D Center, Daikin Industries, Ltd.

1. はじめに

1995年にS.Chou教授(プリンストン大)により提唱さ れた「ナノインプリント」¹⁾は、ガラス転移点(Tg)以上に 加熱したガラスや熱可塑性ポリマーにあらかじめナノ メートルスケールのパターンを刻んだモールドを押し付 け、その後冷却する熱ナノインプリントで50nm以下のパ ターンが容易に形成できることを示した。現在では紫外 線硬化材料(モールド材料)に石英やニッケル(Ni)電 鋳、酸化アルミニウムなどのモールドを押し付けた後、紫 外線を照射する紫外光(UV)ナノインプリントが主流に なってきている。この事は、ナノインプリントがLEDの高 輝度化、ディスプレー用光学フィルム、次世代のハード ディスク(HDD)であるビットパターンドメディア(BPM)等 の応用分野で実用化段階に入り、またロールトゥーロール (R to R)による連続パターニング方法の進歩により生 産性向上・大面積化・パターンの微細化が進んでいる 事を示している。

その中でG.Willson 教授(テキサス大)は2001年 Molecular-Imprints Inc. (MII)を立ち上げ、インクジェッ ト技術を活用したJet and Flash Imprint Lithography (J-FIL)装置とレジスト材料を開発し2Xnm以降1X~ Xnmノードを目指したナノインプリントリソグラフィ(NIL) の実用化を推進した。その結果、次世代リソグラフィー 技術(NGL)が要求する解像性や欠陥減少を達成し²⁾、 極端紫外光(EUV:Extra Ultraviolet)や誘導型自己組 織化(DSA:Directed Self Assembly)と比肩するほど大 きく進展している。

その一方、様々な応用分野で実用化が近づくにつ

れて生産性向上や欠陥減少の要因である離型性の 向上が強く望まれる課題となってきた。我々は石英や酸 化アルミモールド用離型処理剤としてパーフルオロポリ エーテル(PFPE)、主鎖としてシランカップリング基を導 入したオプツールDSX、Ni電鋳テンプレート用にオプ ツールHD2100を商品化³⁾しているが、工業的な量産 適応に伴い耐久性^{4),5)}や離型性の向上要求が厳しさ を増している。そこで我々が培ってきた含フッ素材料を 利用した撥液レジストの技術⁶⁾や界面活性剤の技術を 応用し、レジストやインプリント材料に添加することで離 型性を向上できる材料を設計することとなった。本稿で は、UV-NILで最も重要な課題とされる離型に着目し、 各種のフッ素材料を用いた基礎的な材料開発の検討 に関して報告する。

2. ナノインプリント離型処理方法

ナノインプリントでは加工サイズが小さくなる、パターン が複雑になる、またアスペクト比が大きくなるほど離型性 能の向上が求められる。現在、離型処理方法として主 に図1に示すものが提案されている。モールドとレジスト (又はモールド樹脂)に離型処理を施さない場合(タイ プ1)、モールドをリリースする時にパターンが壊れテンプ レートに付着して欠陥やモールドの汚染の要因となり、 大きな離型力がかかるため基板からの剥離が起こる。 これらは欠陥となり製品の歩留まりを著しく低下させる。 その解決方法が各研究機関やメーカーで開発されて いる⁷⁾。我々はタイプ2、タイプ3、タイプ4の処理方法に 用いられる含フッ素材料の製品化ならびに開発を行っ



図1 ナノインプリント離型処理方法の概要

ている。

以下各タイプの離型材料開発の現状を述べる。

3. モールド塗布型離型剤

パーフルオロポリエーテル(PFPE)を主鎖としシラン カップリング基を導入したオプツールDSX(ダイキン工業 社製)、Ni電鋳モールド用にオプツールHD2100(ダイ キン工業社製)はモールド塗布型の離型剤としてデファ クトスタンダードとなっている。この材料の離型機構は図 2に示すように数Åの薄膜が基材と親油性材料(モノ マー等)との接触を防ぐ界面を形成することで基板にモ ノマーやポリマーが付着する事を防いでいる。



図2 オプツール DSX の離型機構

また PFPE 表面特有の優れた動的静的接触角から 表面自由エネルギーが低くなる事がわかり(表1)、硬 化樹脂は高い表面自由エネルギーであるため両者の 界面がより離型し易くなる。

測定項目	単位	未処理 ガラス	直鎖系 パーフルオロ 処理剤	Optool DSX
耐水接触角	度	<10	110	115
耐オイル転落角	度	(90)	24	3
動摩擦係数		0.57	0.34	0.13
粘着テープ剥離力 =離型性	Ν	3.62	2.35	0.93

表1 オプツール DSX の静的ならびに動的表面性能

この二つの効果の相乗作用により高い離型性が発 現されている。しかし、近年UV-NILにおいて光照射時 に発生するラジカルをPFPEの炭素-酸素結合が吸収 することが電子スピン共鳴分析(ESR)で確認され⁴⁾、ま たUV-NILによる連続パターン形成において1000回以 下で石英モールド表面のPFPE鎖が消失することが報 告された⁵⁾。そのため、より耐久性の高いモールド用離 型剤の開発が望まれている。

4. 含フッ素共重合体型離型剤(タイプ4)

含フッ素共重合体型離型剤はこれまでのフッ素系離 型剤(低分子)と違い、モールドへの転写が起こらず、 またレジスト硬化時に発生するラジカル種からモールド の離型処理層を保護し耐久性が向上する効果が見込 まれる。また長鎖パーフルオロアルキル基を用いず C₄F₉ を側鎖とするa C1アクリレートを主モノマーとした環境対 応型でもある(図3)。



図3 含フッ素共重合体型離型剤の基本構造

我々は、UV-NILへの適用を目指し、種々の光硬化 性モノマーに溶解するよう設計した含フッ素共重合体 を合成した。含フッ素モノマーは離型性能を受け持ち、 レジストやインプリント材料に溶解させるため共重合モノ マーの種類とモノマー比率を合わせ込むテーラーメイド を基本コンセプトとしている。

表2含フッ素共重合体のn-HDに対する静的接触角とPAK-02に対する溶解性

	含フッ素共重合体組成(mass%)							
RUN	Rf (C4) α Cl acrylate	iBMA	TM- 0701T	TISMA	GMA	HEMA	静的 接触角 (n-HD)	PAK-02への 溶解性 (mass%)
1	60	40					64	0.5
	60	30			10		62	-
2	60	30			5	5	61	-
3	45	55					62	1.0
4	45	45			10		61	0.5
	45	45			5	5	59	0.5
	30	70					60	2.0
	60		40				63	0.5
6	45		55				61	0.5
7	30		70				59	0.5
	30		60		10		59	-
	60			40			65	-
8	45			55			63	1.0
	30			70			61	1.0

iBMA : Isobolnyl methacrylate TM-0701T (JCN K. K.) TISMA : 3-(Triisopropoxysilyl)propyl methacrylate GMA : Glycidyl mathacrylate HEMA : 2-Hydroxyethyl mathacrylate

この含フッ素共重合体をシリコンウエハーに100nm 程度の膜厚になるようスピンコートし、乾燥後のノルマル ヘキサデカン(n-HD)に対する静的接触角を測定した

> (表2)。その結果、非常に高い撥油性 を示す事がわかった。またUVナノインプ リント用樹脂 PAK-02(東洋合成工業社 製)への溶解性を測定したところ0.5~ 2.0mass%を示す含フッ素共重合体が 見出された。PAK-02に対して溶解する 含フッ素共重合体を表3に示した量を 添加しスピンコートして薄膜を作成、大 気下で高圧水銀灯により1000mJ/cm²

照射して硬化後のn-HDに対する静的接触角を測定 した。その結果、含フッ素共重合体未添加のPAK-02 は26°と親油性を示したのに対して、添加した硬化体 表面はほぼ含フッ素共重合体単独と同等の撥油性を 示した。

表3 含フッ素共重合体型離型剤添加による撥油性向上効果

RUN	含フッ素共重合体	添加量 (mass%)	静的 接触角 (n-HD)
1	Rf(C4)/iBMA=60/40	0.5	52
2	Rf(C4)/iBMA/GMA/HEMA=60/30/5/	5 0.5	48
3	Rf(C4)/iBMA=45/55	1.0	56
4	Rf(C4)/iBMA/GMA=45/45/10	0.5	46
5	Rf(C4)/iBMA=30/70	2.0	55
6	Rf(C4)/TM-0701T=45/55	0.5	43
7	Rf(C4)/TM-0701T=30/70	1.0	54
8	Rf(C4)/TISMA=45/55	1.0	61
PAK-02	-	—	26

含フッ素共重合体型離型剤の添加量は塗布する主 材料に対して数mass%程度であり、硬化体の表面が 高い撥油性を示したことは添加した量の殆どが表面に 偏析している事を示す。我々は表面に偏析した含フッ 素共重合体層の厚みを斜め切削、飛行時間型二次イ オン質量分析 (TOF-SIMS)の測定により数 nm である ことを明らかとしている。また兵庫県立大学松井教授の グループはX線光電子分光法(XPS)により3nm以下 であると報告しているの。このように主材料の膜厚に対 して非常に薄い膜を形成するため、離型性を付与しな がら主材料の性能を損なわない。表面に偏析させるに は基板と表面との表面自由エネルギー差が大きくかつ 表面側の表面自由エネルギーが低いほどよく偏析す る。この偏析をコントロールする分子設計と工程が重要 なファクターとなる⁸⁾。現在、複数社にてタイプ3+タイプ 4の実用化検討が進んでいる。今後、含フッ素共重合 体が表面に偏析することで光硬化中に発生するラジカ ルとモールド離型剤との接触を妨げる効果、つまりArF 液浸リソグラフィーで用いられるトップコートレスレジスト と同様の機構を示す事が分かれば、現在のモールド離 型剤の課題である耐久性の向上の一助になる可能性 がある。

5. 含フッ素低分子型離型剤(タイプ2)

本材料は1Xnm以下シングルナノメーターと称される パターニング、例えば次世代半導体などにおいて利用 するために必要とされる。PFPEによるモールド離型処 理層は数Åの皮膜を形成するため、その厚みのばらつ きがシングルナノメーターパターニングでは線幅(CD)の 均一性に大きく影響する。そこでモールド離型処理を行 わず、主材料に添加するだけで離型性を発揮する材 料が望まれている。しかし通常の界面活性剤系添加剤 を離型剤として利用する場合2つの問題点がある。一 つはモールド表面に付着する事によるモールドやパター ンの汚染、これは欠陥の原因となる。もう一つは表面張 力が低下することによりレジストやインプリント材料を塗 布する工程において大きな問題を発生する。例えば上 記インクジェット方式を採用した J-FIL ではインク滴の径 が不揃いになり、また滴下後目的とした範囲以上に広 がってしまう。我々は下記に示すコンセプトで新しい材 料設計を行い、表4に示す化合物を合成した。

石英表面と相互作用を持つ側鎖) $C_x F_y$

表4 新規含フッ素低分子化合物の構造

RUN	Rf	C_2H_4	C ₂ H ₄ +C ₃ H ₆ ブロック 共重合体	C ₃ H ₆	Х	
DSN-403N	C ₆ F ₁₃	非開示	-	-	非開示	
1	C ₆ F ₁₃	Mw=200	-	-	Rf and OH	
2	C ₆ F ₁₃	Mw=1000	-	-	Rf and OH	
3	C ₄ F ₉	Mw=200	-	-	Rf and OH	
4	C ₄ F ₉	Mw=400	-	-	Rf and OH	
5	C ₆ F ₁₃	-	Mw=1250	-	Rf and OH	
6	C ₆ F ₁₃	Mw=350	-	-	OCH ₃	
7	C ₄ F ₉	Mw=400	-	-	Rf and OH	
8	C ₄ F ₉	-	Mw=1250	-	Rf and OH	
9	C ₄ F ₉	Mw=350	-	-	OCH ₃	
10	C ₄ F ₉	-	-	Mw=200	Rf and OH	
11	C ₄ F ₉	-	-	Mw=400	Rf and OH	

その結果、離型性を発現しながら表面張力の低下 を抑制する材料を見出した(表5)。主材料に東洋合成 社製 PAK-02を用い、比較例として高い溶解性と優れ た離型性能を示したフッ素系界面活性剤ユニダイン DSN-403N(ダイキン工業社製)を用いた。離型性能は いずれの化合物もDSN-403Nとほぼ同等であったが 添加後の表面張力低下が抑制されている事がわか る。表面張力低下抑制と構造の相関は1)フッ素鎖を短 くする $(C_6 \rightarrow C_4)$ 、2)ポリエチレンオキサイドをポリプロピ レンオキサイドに変える、3)末端はメチルなどでキャップ する、ことで効果がある。今後、モールドへの離型剤の 付着が発生するか、定量的な離型力の評価を行う。

		溶解性(mass%))	表面張力	離型性*
化合物	1.0	3.0	5.0	mN/m	
5	0	0	0	26	良好
8	0	0	0	27	良好
9	0	0	0	27	良好
10	0	0	0	27	良好
11	0	0	0	27	良好
DSN-403N	0	0	0	14	良好
PAK-02	_	_	_	28	不良

表5 新規含フッ素低分子離型剤のPAK-02に対する溶解性と2.0mass%添加時の表面張力と離形性

*:良好=基板・モールドに残渣なし 不良=基板・モールドに残渣あり

5. おわりに

近年急速に実用化に向けてナノインプリント技術開 発が進む中で、「離型」という課題に対しての我々が 行っている取り組みを述べてきた。

次世代の微細パターン形成技術や次世代リソグラ フィー技術としてのナノインプリントは電子・電気に止ま らず医療、ライフサイエンスやエネルギー分野など多様 な応用が検討されている。その中でハード面ではロール トゥーロール(R to R)プロセスによる大面積製造法の 確立や半導体リソグラフィー技術としてはスループットの 向上と欠陥の減少が必須になってくる。ナノインプリント を応用してデバイスを作成する技術開発と同時に材料 に対しては離型性能の向上に焦点があたってきた。今 後、我々はモールド用離型剤のみならずフッ素材料を 素材にした量産化に向けて新たなる離型材料を継続 的に研究開発し市場に提供していくことで、ナノインプリ ント分野の進展に貢献していきたい。

参考文献

- Regents of the University of Minnesota. U.S.Pat. 5,772,905. ;
 U.S.Pat. 6,309,580. ; Chou, S.Y.; Krauss, P.R.; Renstorm, P.J. Appl. Phys. Lett. 1995, 67, 3114. ; Science. 1996, 272, 85-87.
- Colburn, M.; Johnson, S.; Stewart, M.; Damle, S.; Bailey, T.; Choi, B.J.; Wedlake, M.; Michaelson, T.; Steenivasan, S.V.; Ekerdt, J.; Willson, C.G. Proc. SPIE 3676. Santa Clara, USA, 1999, 379-389.; Ye, Z. et.al. Presented at NNT2012. Napa, USA, October 2012.
- 3) ダイキン工業株式会社. 特開 2002-283354.; ダイキン工業株式会社. 特開 2004-351693.
- Truffer-Boutry, D.; Zeismann, M.; De Girolamo, J.; Boussey, J.; Lombard, C.; P.-Donat, B. Appl. Phys. Lett. 2009, 94, 044110.
- Usuki, K.; Wakamatsu, S.; Oomatsu, T.; Hattori, A.; Tarutani, S.; Kodama, K; Tanabe, H.; Shitabatake, K. Proc. SPIE 8323. San Jose, USA, 2012, 832305.
- 6) Daikin Industries, Ltd. WO 2006/129800.; Morita,M.; Kinoshita,Y.; Adachi, Y.; Yamashita, T.; Yamamoto, I. J.Photopolym.Sci.Technol. 2011, 24(4), 401-404.; Oyama, T.; Okada, M.; Iyoshi, S.; Haruyama, Y.; Miyake, H.; Mizuta, T.; Matsui, S. J.Photopolym.Sci.Technol. 2013, 26(1), 129-132.
- 7) 中川 勝. 高分子. 2012, 61, 706-709.
- Yamashita, T.; Yamamoto, I.; Morita, M. Presented at NNT2012. Napa, USA, October 2012. ; Yamashita, T.; Mitsuhashi, H.; Morita, M. Proc. SPIE 8680. San Jose, USA, 2013, 868012

マイクロ波加熱の化学反応への適用: 貴金属ナノ粒子の合成

Application to chemical reactions in microwave heating : Synthesis of noble metal nano particles

四国計測工業株式会社 國井 勝之 Katsuyuki Kunii Shikoku Instrumentation Co., Ltd. 東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻 教授 和田 雄二 Yuji Wada (Pofessor) Tokyo Institute of Technology

1. はじめに

マイクロ波加熱技術は、調理用電子レンジとして一般 家庭に普及している。一方、あまり知られていないが、マ イクロ波加熱技術は、産業技術としても活躍している。具 体的には、ゴム加硫、食品乾燥、木材乾燥、薬剤乾燥 造粒に用いられてきた¹⁾。マイクロ波加熱の迅速加熱、 熱伝導に依らない内部加熱という特性がこれらの利用技 術の中心となっている特長である(図1)。マイクロ波技術 は、その後、Gedyeら²⁾ならびにGiguereら³⁾により化学反 応に初めて適用され、現在では、有機・無機合成のみな らず、製鉄、コーティング等様々な分野で利用されてい る。マイクロ波の加熱原理は、変化する電界に配向しよう とする分子あるいは分子集合体の回転運動エネルギー が、周囲分子との相互作用により熱として散逸する過程 として理解できる。その結果として、被加熱物へマイクロ



図1 マイクロ波加熱と従来の加熱法の特徴(左:迅速加熱、右:内部加熱)

波が照射されると、従来の加熱法である熱伝導とは異な り、分子レベルで内部から均一に加熱される。さらに、マイ クロ波加熱の特徴としては、急速加熱や「内容物は加熱 されるが容器は加熱されない というような、選択加熱等 が挙げられる。これらのマイクロ波加熱の特徴を化学反 応に適用することにより、反応速度の著しい向上4),5),6)、 結晶形状の制御フシ、さらに最近では、光学活性物質の 選択性のコントロール8)など、従来の加熱法にはない様々 なマイクロ波による効果が報告されている。特に、ある種 の有機反応については、マイクロ波照射下で行うと、従 来の加熱法と比較して、1桁~2桁の反応速度の増大、 あるいは100%に近い反応選択性の向上等、際だった 特徴が報告されており、化学者の間では、これをマイクロ 波の特殊効果と呼ぶこともある。また、2013年1月には、 NHKの科学情報番組「サイエンスZERO」においてマイ クロ波技術が取り上げられ、マイクロ波技術は単なる加 熱源としてではなく、21世紀の革新的反応プロセスになり うる技術の一つとして報告
⁹⁾された。

四国計測工業㈱では、東工大和田グループと共同 で、マイクロ波加熱を化学実験へ適用するための専用の 装置を開発し、これまでに様々な化学反応を試み、マイク ロ波利用化学の有用性を報告している¹⁰⁾。本稿では、マ イクロ波加熱の特徴を生かした貴金属ナノ粒子の合成 事例について紹介するとともに、入門機として最適な卓上 タイプの化学実験用マイクロ波加熱装置、ならびにスケー ルアップ装置を紹介する。ここで、ナノ粒子とは、一般に 100 nm以下の大きさの粒子とされており、比表面積がき わめて大きいこと、および量子サイズ効果等の特有の効 果を示すことなど、その特性が、バルクの物性と大きく異 なっていることから、様々な分野で研究が進められてい る。金属ナノ粒子の合成法については、金属バルク材料 の蒸発ガス化と急速冷却凝縮過程を用いて合成する物 理法と金属イオン溶液の還元によって合成する化学法に 大別される。ここでは、マイクロ波加熱による報告例の多 い、化学還元法に限定して解説する。

2. マイクロ波加熱の特徴とナノ粒子の研究開発応用例

2.1 マイクロ波利用化学による銀ナノ粒子合成の例

最初にマイクロ波加熱の利用がいかにナノ粒子合成 に有用であるか銀ナノ粒子合成を例として示す。銀の長 鎖カルボン酸塩を加熱分解すると銀粒子が析出する(図 2)。この反応をマイクロ波照射下で行うと、温度が100K 低下し、反応時間も1/24で、粒径の揃ったナノ粒子合成 が可能となる。銀の長鎖カルボン酸を1-ヘキサノール中 に分散し、マイクロ波照射5min、413Kで反応させると走 査電子顕微鏡(図3)に示すように粒径の揃ったナノ粒子 が合成できる。通常の加熱法(オイルバス)でできる限り





図3 マイクロ波照射下で合成した銀ナノ粒子と通常加熱法との比較(上:オイル バス、下:マイクロ波) 迅速に加熱することで合成した銀粒子では、巨大な粒子 が発生しており、マイクロ波加熱の手法がナノ粒子合成 に最適であることが一目瞭然である。この系で、1-ヘキサ ノールは、マイクロ波を効率よく吸収して高温を実現する 溶媒かつ還元剤として働いている。

2.2 ナノ粒子合成におけるマイクロ波加熱の特徴

化学還元法において金属ナノ粒子を合成する場合に は、通常、金属塩(前駆体)を溶解した溶液中に還元剤 を混入し、加熱することによって、合成を開始する。そこで の金属ナノ粒子合成は、初期の金属核発生とそれに続く 粒子成長の二つの過程から成っている。

従来の加熱法では、反応器内の反応溶液は、まず反 応器壁からの熱伝導により壁際の溶媒が加熱され、溶 液の対流によって系全体に熱が移動してゆく(図4)。こ の加熱プロセスでは、反応溶液と熱源との間の温度勾 配により、ナノ粒子合成の初期に起こる金属核発生が時 間的にも空間的にも不均一なものとなり、結果的に成長し たナノ粒子も広い粒径分布を持つこととなる。一方、マイ クロ波加熱は、熱伝導とは独立の内部加熱法である。マ イクロ波加熱を用いれば、従来の加熱法で問題になる反 応系内の温度勾配を避けることができ、内部からの均一 加熱により、反応系全体で同時に核の発生が可能とな り、それに引き続き起こる粒径成長過程も制御可能となる ため、粒径の揃ったしかも粒径分布の狭いナノ粒子が得 られる(図4)。和田らは、銀ナノ粒子表面に吸着したロー ダミン6G分子が表面増強ラマン散乱(SERS)を与えるこ とを利用し、Agナノ粒子発生時間をマイクロ波照射下と 通常加熱下で特定することに成功し、マイクロ波照射下 では、反応器内の中心と器壁で同時に銀ナノ粒子発生



図4 マイクロ波加熱と従来の加熱法におけるナノ粒子発生スキーム

が起こっていることを証明した(図5)11)。

マイクロ波加熱の特長としての迅速加熱も粒径分布 の狭小化に有利に働いている。図1には、マイクロ波加 熱と従来の加熱法における昇温曲線を示している。主反 応が生じる温度よりも幾分低い温度領域は、一般に副反 応が進行しやすいとされている。この温度域を通過する のに要する時間をマイクロ波加熱と従来の加熱法で比較 した場合、従来の加熱法ではゆっくりと時間をかけて通 過するのに対し、マイクロ波加熱では、短時間で通過す



図5 ラマン分光を用いたマイクロ波照射下でのin situナノ粒子発生観測



図6 ミリスチン酸銅を前駆体としてマイクロ波利用合成した銅ナノ粒子



図8マイクロ波照射による構造精密制御ナノ粒子合成;銀コア-銅シェル粒子

ることが可能となる。ナノ粒子合成において、この温度領 域は、核発生や粒成長が開始するとされる温度域であ り、従来の加熱法ではゆっくりとその温度域を通過するこ とから、長い時間の間に起こる不均一な核発生となり、そ の結果、広い粒径分布をもつナノ粒子となる。一方、マイ クロ波加熱では短時間にこの温度域を通過することによ り、均一核発生とそれに続く均一な粒成長が可能となり、 粒径分布の狭いナノ粒子が得られることとなる。

2.3 貴金属ナノ粒子の研究開発応用例

和田らは、マイクロ波加熱を用いて、銅 ナノ粒子合成方法¹²⁾(図6)、ニッケルナノ 粒子合成方法¹³⁾(図7)を開発した。それ ぞれ、従来の方法に比べて、小さなナノサ イズ化・粒径分布の狭小化が達成され、 粒径の制御も可能となっている。マイクロ 波の高い制御性を用いることによりハイブ リッド構造を有するナノ構造体を精密合成 できることもわかっている。図8には、銀の ナノサイズのコアに銅のシェルを被覆した 構造体、銀コア-銅シェルナノ粒子合成を 示した¹⁴⁾。



図7 マイクロ波合成したニッケルナノ粒子:C18(オレイルア ミン)、C14(ミリスチルアミン)、C12(ラウリルアミン)、 C8(オクチルアミン):463 K、10minマイクロ波照射

3. 銀ナノ粒子の合成

マイクロ波加熱による銀ナノ粒子の合成は、和田らの 報告15)をはじめ、多数のグループ16)により研究されてい る。銀ナノ粒子の用途として最も注目されている分野は、 接合やプリンティングの分野であり、銀ナノ粒子をインクと して使用することを目的としている。これらの分野におい て、銀ナノ粒子が使用される理由として、ナノ粒子化によ る融点の急激な低下が挙げられる。すなわち、バルクの 銀の融点は960℃付近であるが、ナノ粒子化することで、 粒径や合成法にもよるが、250℃以下にまで融点を下げる ことが可能となる。しかしながら、銀ナノ粒子をインクとして 使用するためには、高濃度化・大量合成技術が不可欠 であり、さらに、電子部品に使用する場合、窒素、硫黄、リ ン等の元素の混入は避ける必要がある。一方で、ナノ粒 子が安定に独立分散して存在するためには、ナノ粒子の 表面を表面修飾剤で覆うことが不可欠とされており、その 表面修飾剤の多くには、これらヘテロ元素を含むオレイル アミン等のアミン類、ポリビニルピロリドン等の高分子が使 用されている。

國井らは、東工大和田グループと共同で、マイクロ波加熱による新規の銀ナノ粒子合成法を開発した。この系では、銀ナノ粒子は標準で10%(w/w)濃度であり、リッタースケール(1.5L~6.5L)まで対応可能である。さらに、表面修飾剤に窒素、硫黄原子等は含まれておらず、銀以外に含まれている元素は炭素、酸素、水素のみである。n-ヘキサンで希釈して測定した銀ナノ粒子の透過型電子顕微鏡画像を図9に示すが、粒径が均一で狭い粒径分布を有することが分かる。現在、この銀ナノ粒子の



図9 マイクロ波加熱により合成した銀ナノ粒子

ほか、白金や金ナノ粒子の合成法も確立し、多岐な用途 への発展を図っている。

4. マイクロ波加熱装置について

4.1 卓上型マイクロ波加熱装置「µリアクターEx」

ナノ粒子合成のような化学反応をマイクロ波加熱で行 う場合、攪拌や温度制御などが不可欠であり、再現性の 面も含めて、市販の電子レンジでは対応が困難である。 化学実験に使用可能な卓上タイプのマイクロ波加熱装 置は、種々のメーカから販売されているが、四国計測工業 (株)も、図10に示すような卓上タイプの化学反応用マイ クロ波加熱装置「μリアクターEx」を開発し、製造販売を 行っている。装置の仕様は、周波数2.45 GHz、最大出 力1 kW であり、マイクロ波の一定出力または PID 出力制 御による加熱が可能である。特徴としては、化学反応に 必要とされる攪拌機能(マグネチックスターラ、またはメカ ニカル攪拌)、温度計測機能、還流管の取り付けが可能 であること等が挙げられる。その他、安全対策としては、 マイクロ波照射下でのドア開閉時の緊急停止、上限温 度設定および温度異常による緊急停止機能を有し、管 理面では、付属のロガーによるマイクロ波出力および温度 データの取り込みを可能としている。



図10 μリアクターExの外観写真

4.2 マイクロ波大型反応装置

マイクロ波加熱装置を大型化する場合、単に卓上型 装置を大きくするだけでは、小スケールで得られた実験の 再現に至らない場合が多い。小スケールでの実験におい て、マイクロ波のどのような効果が実験結果に影響してい るかを見極め、装置設計に反映することが重要である。 ナノ粒子合成の場合、前述のように、均一加熱、急速加 熱が重要なファクターであり、均一加熱を実現するために は、使用する溶媒でのマイクロ波の半減深度を考慮した 釜サイズの設計が求められる。また、急速加熱からは、昇 温速度と使用する溶媒の比熱により、必要とされるマイク 口波出力ならびに釜容量が算出される。ナノ粒子合成を 目的の一つとして作られた、大型釜型反応装置を図11 に示す。 釜容量は 6.5L (最大 8L まで) であり、 釜容量か ら見れば大型とは言い難いが、マイクロ波の急速加熱に よる反応時間の短縮を考慮すれば、その生産能力は同 サイズの従来法の装置と比較して数倍~10数倍となる。 マイクロ波出力に関しては1.5~6kWの発振器が3台接 続可能であり、必要とされる昇温速度に応じてマイクロ波 出力を決定する。また、本装置はバッチ反応用の装置で あるが、複数の釜を連結することにより、連続槽型反応 装置としても使用可能である。四国計測工業(株)では、 ナノ粒子以外にも重縮合反応など、種々の反応に適した 実用化装置を手がけており、詳細については、ホーム ページ17)に紹介されている。



図11 大型釜型反応装置

5. おわりに

マイクロ波加熱は、電子レンジとして一般家庭にまで普 及している加熱技術であるが、内部加熱、急速加熱、選 択加熱等の特徴を化学反応へ適用することにより、一加 熱技術にとどまらず、様々な効果が期待される。金属ナノ 粒子合成では、マイクロ波の内部加熱、急速加熱の特 徴を生かすことで、粒子径が均一で狭い粒径分布を有 するナノ粒子が得られることを示した。また、マイクロ波加 熱装置については、卓上型マイクロ波加熱装置および大 型釜型反応装置を示し、ナノ粒子合成での大型化の事 例について紹介した。

本稿で取り上げた技術あるいは製品によって、科学技 術の発展に寄与できれば幸いである。

参考文献

- 1) 越島哲夫編集.マイクロ波加熱技術集成.(株)エヌ・ティー・ エス, 1994, 800p.
- Gedye, R.; Smith, F.; Westaway, K.; Ali, H.; Baldisera, L.; Laberge, L.; Rousell, J. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 279-282.
- Giguere, R.J.; Bray, T.L.; Duncan, S.M.; Majetich, G. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 4945-4948.
- 4) 竹内和彦,和田雄二監修.マイクロ波化学プロセス技術II.
 (株)シーエムシー出版, 2013, 300p.
- 5) Edited by Loupy, A. Microwaves in Organic Synthesis. Wiley-VCH, 2006.
- Kappe, C.O.; Dallinger, D.; Murphree, S.S. Practical Microwave Synthesis for Organic Chemists. Wiley-VCH, 2009, 310p.
- 7) Tsuji, M.; Miyamae, N.; Hashimoto, M.; Nishio, M.; Hikino, S.; Ishigami, N.; Tanaka, I. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2007, 302(1-3), 587-598.
- Nushiro, K.; Kikuchi S.; Yamada T. Chem. Lett. 2013, 42(2), 165-167.
- 9) http://www.nhk.or.jp/zero/contents/dsp414.html
- 10) 和田雄二, 鈴木榮一. 触媒. 2013, 55(1), 44-50.
- Tsukahara, Y.; Nakamura, T.; Kobayashi, T.; Wada, Y. Chem. Lett. 2006, 35(12), 1396-1397.
- 12) Nakamura, T.; Tsukahara, Y.; Sakata, T.; Mori, H.; Kanbe, Y.; Bessho, H.; Wada, Y. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2007, 80(1), 224-232.
- 13) Yamauchi, T.; Tsukahara, Y.; Sakamoto, T.; Kono, T.; Yasuda,
 M.; Baba, A.; Wada, Y. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2009, 82(8), 1044-1051.
- 14) Nakamura, T.; Tsukahara, Y.; Yamauchi, T.; Sakata, T.; Mori, H.;
 Wada, Y. Chem. Lett. 2007, 36(1), 154-155.
- 15) Yamamoto, T.; Wada, Y.; Sakata, T.; Mori, H.; Goto, M.;
 Hibino, S.; Yanagida, S. Chem. Lett. 2004, 33(2), 158-159.
- 16) Edited by Horikoshi, S.; Serpone, N. Microwaves in Nanoparticle Synthesis : Fundamentals and Applications. Wiley-VCH, 2013, 352p.
- 17) http://www.yonkei.co.jp/products/industrial/micro/

新・私の古生物誌(10)

New Series of My Paleontological Notes (10)

— 生きている化石ヘラチョウザメ -

- Paddlefish as Living Fossils -

医学博士 福田 芳生 M. Dr. YOSHIO FUKUDA

1. はじめに

前回チョウザメについて述べました。このチョウザメの 卵はキャビアとして知られ、世界の3大珍味の筆頭に挙 げられています。このチョウザメの仲間にヘラチョウザメ がいます。

上顎にパドルを備えた、奇怪な姿をしているためでしょ

うか、いつもチョウザメの陰になって、一向に目立ちません。でも、8,000万年もの長大な歴史を、その体内に秘めているのです。

このヘラチョウザメは微小なプランクトンを栄養源にす る、大変地味な生活を送っています。今回、ヘラチョウ ザメにスポットライトを当て、身体の仕組みや独特のパド ルに係わる進化について述べることにします。



シシッピ河流域に生息するヘラチョウザメと、中国の長江 (揚子江)に棲むヨウスコウヘラチョウザメの2種類があ ります。本論ではアメリカ産のヘラチョウザメについて述 べることにします。

ヘラチョウザメは上顎が扁平な突起となって伸び出しています(図1のa)。この突起はボートを漕ぐ櫂(かい) によく似ています。英語で櫂を指して、パドルと呼びま す。そして英語のパドルフィッシュは、実によくヘラチョウ 図1 a は現生のヘラチョウザメ、b はパドルを支える籠状の骨組織(a は M. ジョ リー、b は L. グランデとW.E. べミスによる)。

ザメの特徴を言い表しています。和名のヘラチョウザメ は、学名のスパチュラ(ヘラ)に由来しています。 このパドルは体長の1/3 近くあります。ちなみに、ヘラ チョウザメの成魚は体長1.8メートル、重量も80キログラ ムに達します。全長7メートルもの大物がいるとの話です が、記録では3メートルが最大です。全体に雄よりも雌 の方が大型で、それは抱卵することによっています。

パドルは骨で支えられています。この骨が緻密な板状 であったなら、身体の重心が体前方に偏ってしまうの で、遊泳に支障を来すでしょう。そこは実にうまい具合に なっていて、全体に目の粗い竹籠にそっくりな構造に なっています(図1のb)。それだと適度に強度を保ち、 重量も抑えられます。外側は皮膚で覆われます。このパ ドル下面後方に、1対の短いヒゲがあります。 硬鱗が体表にずらりと並んでいます(図2)。ところが、ヘラ チョウザメでは尾鰭の付け根や鰓蓋の表面に、1ミリメート ル以下の微小な鱗が認められるにすぎません(図3)。

尾鰭は上方が大きく下方が小型の、いわゆる異尾で す。背側後方に背鰭があり、胸鰭、腹鰭、尻鰭が順に並 びます。鰓蓋は大形で、その末端は鋭く尖ります。口は通 常の魚と同様、体前方にあって、大きく開くことができます。 パドルの基部に1対の小さな目があります(図1のa、図6 のb)。鰓蓋上方の側線は、体後方に向かって走ります。

2.3 ヘラチョウザメの感覚器

ヘラチョウザメの食物は、専ら水中の微小な動物性 プランクトンです。短いロビゲは水中の食物探査には、 あまり役立っているとは思えません。スエーデンのヨルゲ ンセン博士のグループは、魚類の感覚器官について

2.2 ヘラチョウザメの微小な鱗

チョウザメでは、チョウの羽根を思わせる大形の板状



図3 ヘラチョウザメの微細な鱗。aは鰓蓋表面の鱗の分布状態を示す。b~cは鱗の拡大。bは上側、 cは側面、鱗は長さ1ミリメートルほどある(G.F.ワイゼルによる)。

図4 ヘラチョウザメのパドル下面にあるローレンツィニ 器官。図は縦断面を示す。上から順に開口部、短 い管、次いでビン状の膨大部。内部はニカワ状の 物質で満たされている。底部に3個の感覚細胞が 並んでいる。細い神経線維(黒色部)が、感覚細胞 に接している(J.M.ヨルゲンセンほかより改写)。

数々の優れた研究成果を発表しています。

このヨンゲルセン博士のグループは、ヘラチョウザメの パドルに分布する感覚器官を調べ、それがサメ類の持 つローレンツィニ器官と基本的な構造に於いて、ほとん



ど変わりないことを突き止めました(図4)。

そこで、ローレンツィニ器官とは如何なるものか、その 構造と機能について説明しましょう。サメ類の吻部下側 の皮膚表面には、無数の小孔が開いています(図5の a)。小孔に続く細長い管は、ドロリとしたニカワ状物質で 満たされ、体表下に深く埋没しています(図5のb)。

その末端が膨れ上がってビンのような形になっていま す。ビンの底部に感覚細胞群があり、神経線維と連絡し ていて、その刺激が中枢(脳)に送られます。第二次大 戦直前の1938年、サンド博士の研究報告によって、海 水温の変化を察知する温度受容器と考えられました。

近年になって研究が進み、ローレンツィニ器官の密集 するサメの吻部を透明な電気絶縁膜で覆うと、獲物に 全く反応しなくなることが分かりました。獲物は魚で、ロー レンツィニ器官は相手の筋肉や心拍動によって生じる活 動電流をキャッチする、高性能の電気受容器であること が、はっきりしたのです。

ヘラチョウザメはパドル下面のローレンツィニ器官で、 微小なミジンコや小エビの筋運動・心拍動によって生じ る活動電流を感知し、その所存を確認します。次いで、 口を大きく開いて水と一緒にプランクトンを呑み込みます $(\boxtimes 6\mathcal{O}a)_{\circ}$



や古のため、シノヨークル。のは、クノヨークルの頃前の、ロハルクショーのによるは一方 ある。c には櫛の歯のような繊細な鰓耙(写真左側の白色部)。この鰓耙でブランクト ンを濾し採る(aは B. グルチメク、b~cはL. グランデとW.E. べミスによる)。

3. ヘラチョウザメの鰓耙と消化管

ヘラチョウザメの口内には、全く歯を認めることができ ません。細かな櫛(くし)の歯のような鰓耙(さいは)が咽 頭部両側にあります。ヘラチョウザメは、この鰓耙で食 物となる動物性プランクトンを濾し採ります(図6のc)。

細かい鰓耙の表面には、密に粘液分泌細胞が並ん でいて、不純物を分泌液で包み、体外に捨て去ります。 食物は食道を経て胃に送られます。

3.1 胃と腸管

モンタナ大学の動物学者ワイゼル博士は、ヘラチョウ ザメの消化管について、その構造を熱心に光学顕微鏡 で観察しました。まず胃の近位部を切り開くと、内壁に幾 筋もの柱状構造が認められます(図7のa)。

チョウザメと同様、繰り返すまでもなくヘラチョウザメに は歯がありません。チョウザメでは胃壁に厚い筋層を備 え、鳥類の砂肝(すなぎも)のように食物を押し潰します。 それは歯の代わりということになります。

ワイゼル博士は柱状構造について、当初歯の代用を する筋肉の束と考えました。組織標本を顕微鏡で覗く と、何とそれは脂肪の塊だったのです(図7のb)。胃壁 の脂肪柱は胃内に溜まったプランクトンを、そっと包むよ うにして、後方の腸に送り出す仕掛なのだそうです。ヘ ラチョウザメは微小なプランクトンを、さらに細片にする 必要はないのでしょう。 胃と腸の接続部に、広い腔所を有する幽門垂があり ます(図7のa)。ワイゼル博士は、この幽門垂の働きに ついて次のように述べています。腔所の内部で水分を 吸収し、プランクトンの密度を高め、消化液と混合すると いうものです。後方に螺旋弁を備えた腸が続きます。そ の様子は、他のチョウザメ同様です。

ただ、純淡水性のヘラチョウザメでは、腸管内部に 吸虫や条虫類が常在しています。それらの寄生虫によ る、腸内壁の損傷に対処するためでしょうか、多数のリ ンパ節が認められるそうです。

4. ヘラチョウザメの生息場所と繁殖

ヘラチョウザメはミシシッピ河流域の、水深が1メート ル以上あって、流れの比較的緩やかな場所に生息して います。そして、水底が粘土質の場所を好みます。

ヘラチョウザメは夜行性で、昼間は水底でじっとして います。粘土の細粒が混じった水域に棲み、視力が弱 く、索餌は専らパドルのローレンツィニ器官に頼らざるを 得ないのも、生息環境と大いに関連があります。

水温が13℃に達する4月から5月にかけて、上流の 小石の間に産卵します。1週間ほどで孵化し、すぐに泳 ぎ始めます。稚魚は体長30ミリメートルを超えると、パド ルが明瞭になります。この段階になると、もうミクロの餌を 探し始めます。



図7 ヘラチョウザメの胃壁の構造。aは胃近位部の幽門垂、幽門に続く腸管、胃内壁に縦走する柱状の隆起物がある。bは胃壁断面。柱状の隆起物は脂肪の塊。図中のFは脂肪組織を示す(G.F.ワイゼルによる)。

5. ヘラチョウザメの化石と進化

5.1 進化の分岐点に位置するペイピアノステウス

孵化後間もないヘラチョウザメの稚魚には、パドルが ありません。1億2,500万年前の白亜紀初期に、中国大 陸の湖に出現したヘラチョウザメに近いペイピアノステ ウス・パニィもパドルを持っていませんでした(図8のa)。

このペイピアノステウスは体長3.2メートルもあって大 形の目を持ち、口が頭部正面に開いています。昼間活 発に泳ぎ回り、微小なプランクトンを鰓耙で濾し採ってい ました。

グランデとベミス両博士(1996)の研究では、ペイピア ノステウスの口中には濾過採餌用の鰓耙の他に、立派 な歯が認められ、時には魚や甲殻類も捕食していたよう です。

ペイピアノステウスは、チョウザメと後のヘラチョウザメ の分岐点に位置する魚ということになります。冒頭のヘ ラチョウザメの稚魚は、出現初期のヘラチョウザメ類の 特徴をよく反映していると申せましょう。

5.2 モンタナのヘラチョウザメ

恐竜化石の産地として有名なモンタナ州から、約 8,000万年前(白亜紀後期)のヘラチョウザメの化石が 発見されています。それは1940年のことです。古生物 学者のマックアルピン博士は、モンタナ州の恐竜時代の 地層を調査していました。その折り、当時の湖の堆積物 から、頭と尾の一部が残った不完全な魚の化石を見つ けました(図8のb)。

詳しく調べると、上顎が異常に伸長していて、それは 現生のヘラチョウザメのパドルに相当することが分かりま した。このモンタナの化石は、復元すると体長1メートル ほどになります。パレオプセフルスと命名され、目下最古 のヘラチョウザメと目されています。

5.3 5,000万年前の巨大な湖

鉱物標本屋さんに足を運ぶと、北アメリカのグリーンリ バー層産と称する小さな淡水魚の化石が店頭に並ん でいます。このグリーンリバー層はワイオミング・コロラド・ ユタ州に分布し、その総面積は65,000平方キロメート ルに及びます。

それは今から約5,000万年前の巨大な湖の堆積物 によって構成されています。その主体は石灰分の多い 木目細かな頁岩層からなり、厚さ600メートルにも達して います。なにしろ1,500万年もの間、巨大な湖として存続 したのですから、地層中に含まれる化石は莫大な量に のぼります。

化石は大変保存が良く、第三紀始新世の動物や植物の情報を今に伝えています。様々な淡水魚の他に、 熱帯に生育するヤシ、そしてヘビやワニ、スッポン、鳥類 の他にコウモリの化石が報告されています。



図8 恐竜時代のヘラチョウザメ。aは中国大陸の1億2,500万年前(白亜紀初期)の湖に生息していたヘラチョウザメの先駆者ペイピアノステウス・パニィの復元図。体長3.2メートルもあった。bは北アメリカモンタナ州の約8,000万年前のヘラチョウザメ、パレオプセフルス。体長1メートルほどあった(aはL.グランデとW.E.ベミス、bはA.マックアルピンによる)。



図9約5,000万年前の巨大な湖に生息していたヘラチョウザメ。aはクロソフォ リス・マグニコウダタスの全形。体長50センチメートルほどあった。この標本 はかつてコープ博士の研究した記念すべきもの。bはクロソフォリスの体表 に分布していた鱗。大きさ1ミリメートルほど(a~bはL.グランデによる)。

イリノイ州シカゴの自然史博物館に勤務するグランデ 博士は、1984年にグリーンリバー層の化石を網羅した、 300ページもの分厚い論文を出版しています。その研究 成果からすると、当時の湖は岸辺にヤシの茂る、かなり 温暖な気候のもとにあったことが分かります。



5.4 グリーンリバー層のヘラチョウザメ

さて、グリーンリバー層の古 生物に関する最初の科学的 な論文は、パーカーが1840年 に、ついでフレモントが1845年 にそれぞれエビの化石につい て述べています。

そして、ジョン・エバンスが 1856年にグリーンリバー層か ら掘り出した魚の化石を丁寧 にスケッチして、論文にしまし た。以来、多くの古生物学者 が、グリーンリバー層の脊椎動 物に注目するようになりました。

1883年のことです。恐竜化 石の大家コープ博士の研究 室に、全長50センチメートルほ どある奇妙な魚の化石が運び 込まれました(図9のa)。博士 は化石を慎重に調べ、上顎の 突出物に着目し、その構造が







現生のヘラチョウザメの持つパドルと変わりないことを知 りました。かくして、奇妙な魚の化石は、ヘラチョウザメで あることが明らかになりました。そして、クロソフォリス・マ グニコウダタスと命名しました。クロソフォリスは全身小さ な鱗で覆われています(図9のb)。

5.5 パドルの機能が確立する

恐竜時代のヘラチョウザメの化石を発見して有名に なったマックアルピン博士は、グリーンリバー層のヘラチョ ウザメ、クロソフォリスを再検討し、頑丈な歯を持っている ことを突き止めました。

そして、胃内に魚の骨や甲殻類、砕かれた貝殻があ ることに気付きました。その結果、マックアルピン博士は クロソフォリスが、パドルを用いて川底の泥を掘り起こし、 それらの動物を捕食していたと考えました。それはパド ルが、シャベルのような機能を持っていたということになり ます。

この太古のヘラチョウザメ、クロソフォリスが生息する 湖で、ワニのような鋭い歯を持つ獰猛な肉食魚レピソス テウス(図10)やアミア(図11)が勢力を増します。ヘラ チョウザメは次第に湖から、その周辺の河川に追いやら 図11 レピソステウス・アトロックスと同時代に生息していた肉食魚アミア・ウイン タエンシス。aは全形の復元図。体長124センチメートル。bは頭部側面。 長さ30センチメートル近くある(L.グランデによる)。

れます。その際、今迄補助的だった濾過採餌法が主体 になります。

さらに、捕食者の目を逃れるため、濁った粘土質の水 底を好むようになります。そして、ミクロの食物を得るに は、視覚に頼るよりもローレンツィニ器官を用いる方が、 ずっと効率が良いことです。パドル下面にローレンツィニ 器官が集中します。パドルで水底の泥を掘る行為は、 精巧なローレンツィニ器官の損傷を招きます。

泥掘りを止めたことで、パドルは専ら素餌用のセン サー並びに安定版として、機能するようになったのでしょ う。それが現在のヘラチョウザメという訳です。無論、そ うなる迄に気の遠くなるような時間が掛かっています。

6. 終わりに

以前、北アメリカのミシシッピ河流域には、多くのヘラ チョウザメが生息していました。でも、ダムの建設や深刻 な水質汚染によって、絶滅が危惧される事態になってい ます。人畜無害とは、正にヘラチョウザメを指す言葉と 言っても過言ではないでしょう。

イラク戦争によって、キャビアの生産量が激減しました。するとヘラチョウザメに目を付けて乱獲し、その卵からキャビアを生産しました。かくして、ヘラチョウザメは絶滅寸前まで、追い詰められました。

現在、アメリカ政府は厳しく捕獲制限し、稚魚の放流 を行うなど、その保護に懸命になっています。努力が実 を結んで、徐々に個体数が増加し始めたとのニュース に、筆者はほっと胸を撫で下ろしています。

ViewaBlue® Stain KANTO染色による アガロースゲルからのDNA回収における問題点の解消

Resolution of technical issues on DNA recovery from agarose gel by ViewaBlue[®] Stain KANTO

(独)農業,食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所 食品工学研究領域 高橋 宏和、松本 敦子、金原 浩子、杉山 滋、小堀 俊郎 Hirokazu Takahashi, Atsuko Matsumoto, Hiroko Kanahara, Shigeru Sugiyama, Toshiro Kobori Food Engineering Division, National Food Research Institute, National Agriculture and Food Research Organization 関東化学株式会社 技術・開発本部 伊勢原研究所 生化学研究室 山嵜 裕之、千室 智之 Hiroyuki Yamazaki, Tomoyuki Chimuro Isehara Research Laboratory, Technology & Development Division, Kanto Chemical Co., Inc.

> 関東化学株式会社 試薬事業本部 試薬部 技術部 バイオケミカル課 小林 県良 Takayoshi Kobayashi Biochemicals, Reagent Development Department, Reagent Division, Kanto Chemical Co., Inc.

In this paper, we describe the results of DNA staining with ViewaBlue[®] Stain KANTO, a reagent for recovering DNA from agarose gels. ViewaBlue[®] stained DNA migrated as a band in the gel after or during electrophoresis, and DNA bands were easily visualized under natural light. The DNA recovered from the band showed little damage because the visible light spectrum only slightly covers ultraviolet wavelengths in the laboratory environment. In addition, ViewaBlue[®] had little mutagenicity; therefore, ViewaBlue[®] provides a simple and safe means of performing experimental procedures including staining, observation, and recovery of desired DNA without dedicated devices.

1. はじめに

デオキシリボ核酸(DNA)やリボ核酸(RNA)を検出す る際、アガロースゲルによる電気泳動で分離した試料を エチジウムブロミド(EtBr)によって染色し、ピーク波長が 260 nmの紫外線(UV-C)を照射することによって可視 化することが一般的である。染色方法は二通りに大別さ れ、予めEtBrを添加してアガロースゲルを作製して電気 泳動に使用する、いわゆる「先染め」と、EtBrを添加せ ずにアガロースゲルを作製し、電気泳動後にEtBr染色 液に浸す「後染め」である。「先染め」は電気泳動中に 核酸の分離状況を確認することが可能であり、泳動後 にゲルを染色する必要がないことから検出時間が短縮 できる。ただし、EtBrは変異原性物質1)であるため、ゲ ルや電気泳動緩衝液の取り扱いには注意を払う必要が ある。「後染め」は、電気泳動緩衝液の取り扱いは簡便 であるが、検出まで時間がかかる(約30分)、染色液や 染色後のゲルの取り扱いには注意が必要である。このよ

うに、いずれの方法にも長所と短所があるためどちらを 採用するかは研究室によって異なるものの、EtBr染色は 試薬の安定性、ランニングコスト、高い検出感度の点か ら、アガロースゲル電気泳動での核酸検出に汎用されて いる。

アガロースゲルで分離したDNAをゲルから回収して 別の実験(例えば塩基配列解析やクローニング)に使う ことがしばしばあるが、EtBr染色ではアガロースゲルか らDNAを回収する工程で細心の注意を払わないと継続 して行う実験がうまくいかない。DNAはチミンやシトシンの ピリミジン塩基とアデニンとグアニンのプリン塩基から構成 されるが、このピリミジン塩基が2つ近接しているときに UV-Cが照射されると、2個の塩基間で架橋が生じてピリ ミジンダイマー(図1)が形成される²⁾。ピリミジンダイマー が生成したDNAは、PCRや塩基配列解析の反応の鋳 型としても、またはプラスミド等を利用した大腸菌などの 宿主細胞によるクローニングにおいても著しく効率が低 下する。そのためアガロースゲル中のDNAを回収する 場合には工夫が必要となる。すなわち、DNAを確認用 レーンと回収用レーンの二つのレーンに分けて泳動を行 い、確認用レーンにだけ紫外線を照射して目的DNAの 位置を確認する一方で、回収用レーンではアルミホイル 等で覆うことにより紫外線を照射せず、確認用レーンで の位置を参照して目測で目的DNAを切り出す(図2)、と いった手技がとられる。またこの操作は、確認用レーンか ら目的DNAを目視で確認するために暗室で行い、さらに 実験者を有害な紫外線から目や皮膚を防御するために 専用の保護具を使用するといった結構手間のかかる手 法が未だに使われている。また、現在ではUV-Cのみな らずUV-AやBの照射を選択できる機器があり、UV-C







図2 EtBr 染色におけるアガロースゲルからの目的 DNA 断片の回収 確認用ゲルの目的 DNA (黒矢印)を目安として、回収用ゲルから目的 DNA が有ると予想されるゲル部分 (白矢印)を切り出し、回収する。

照射に比べてEtBrの蛍光強度が減少するものの、 DNAへのダメージを低減させることを第一に考えて UV-AやUV-Bで作業を行うこともある。ただし、暗室で UV照射を短時間で行う必要があるなど、UV-C照射と 同様に操作上の制約がある。

そのためDNA 回収を簡便に行うために、近年 EtBr に代わる様々な核酸検出用蛍光色素が各社から販売さ れている。これらの蛍光色素は励起波長が紫外光では なく可視光(400-800 nm)であるため、DNAに対するダ メージはほとんどない。しかし、暗室等に加えて可視光を 照射する専用の機材と試薬が必要であり、新たにシステ ム導入のための初期投資が必要となる³⁾。多くの研究室 には既にEtBr染色用の機材が導入されているため、ア ガロースゲルからのDNA 回収のためだけにこうした試 薬や機材を新たに導入するのにはいささか抵抗がある と思われる。

2. 塩基性核酸染色試薬

アガロースゲルにおける核酸染色試薬としては非蛍光 の染色薬、例えばメチレンブルー等の塩基性の染色薬 が古くから知られている4-5)。これらの塩基性染色試薬の 中でも酢酸カーミン溶液は、小中学校の顕微鏡観察でも 細胞の核を染めるのにも使われているので聞き覚えがあ る人も多いかと思う。核酸はその構造中に多数のリン酸 基があるため全体として負電荷を帯びた分子であり、正 電荷を帯びている塩基性染色試薬と静電的に結合す る。また、色素自身が特定の色を有しているためDNA検 出に紫外線照射や検出用機器が不要である。さらに核 酸との結合様式がEtBrとは異なり2本鎖 DNA内にイン ターカーレートしないため、使用者にとっても安全な核酸 染色試薬として認知されている。一方、塩基性の核酸染 色試薬は染色液の調製が煩雑であることに加えて、検 出時間が長く感度が低いといった短所があるため 6-7)、 通常の分子生物学実験で用いられることは少ない。

アガロースゲルからのDNA回収における問題点を踏まえて、筆者らは導入費用が安価で、DNA回収に十分な検出感度を持ち、かつ簡便で安全性の高いDNA染色試薬の開発を要望していた。本稿では、DNA回収に適した新しいDNA染色試薬であるViewaBlue[®] Stain KANTO(以下 ViewaBlue[®])の使用事例を報告する。

3. ViewaBlue® Stain KANTOによるDNA 染色

ViewaBlue[®]によるアガロースゲルのDNA染色には、 EtBr染色と同様に「先染め」と「後染め」の2通りの染色 方法が選択できる。一般的な塩基性のDNA染色試薬が 「後染め」であるため利便性が向上したと言える。そこ で、各染色方法で検出までにかかる時間と検出感度を 評価した。この際、試料DNAとしてプラスミドDNAの pAcGFP-1(クローンテック社)を制限酵素 EcoRIで切断 して精製した後、段階希釈により様々な濃度に調製した DNA 溶液を用いた。



図3 後染めにおける ViewaBlue[®] Stain KANTOの検出感度 レーン上部の数字は泳動に使用した DNA 量 (ng)を示す。また、黒矢印は 目的 DNA (pAcGFP-1, EcoRI 切断済み)の位置を示す。 初めに、「後染め」法において検出までに要する作業 時間と検出感度を検討した。アガロースゲル電気泳動 (約30分間)後、ゲルをViewaBlue®に浸し、5分間静置 した。その後、ゲルを精製水に浸して5分間振盪する脱 色作業を2回繰り返した後、自然光下で目的DNAを観 察した(図3)。「後染め」における作業時間は電気泳動 の時間を含めても1時間以内に終了するため、EtBr染 色の「後染め」と同程度である。ゲルに白色光を照らし、 コントラストを上げると、目視で約5~10 ngのDNAが確 認でき、EtBr染色したゲルをポラロイドカメラで撮影した 場合には4 ng程度のDNAが確認できることから、検出 感度も同程度であった。ちなみに、脱色作業を30分程 度延長すればより鮮明な泳動像を得ることができる。

次に、「先染め」での検出までに要する作業時間と検 出感度を検討した。ViewaBlue®を最終濃度で1%となる ように添加したアガロースゲルと泳動用緩衝液(1xTAE) を電気泳動に使用した。電気泳動中にDNAバンドが観 察できるかどうかを検討するため、泳動開始から15分お よび30分後に自然光下で目的DNAを観察した(図4)。 泳動像そのものは「後染め」に比べて分離能が劣るが、 白色光下の目視では、約20~50 ng程度のDNAが視 認された。「後染め」法と比べると、ゲルおよび泳動用緩 衝液の作製に多少の手間がかかる上、検出感度も低下 しているが、泳動中あるいは泳動後すぐに観察できるた め、DNA 回収等の作業に速やかに移ることができると いった利点がある。



図4 先染めにおける ViewaBlue[®] Stain KANTOの検出感度 左は泳動後15分後、右は30分後に観察。レーン上部の数字は泳動に使用したDNA量(ng)を示す。また、黒矢印は目的 DNA の位置を示す。 市販のDNA回収用キットを用いてDNAを回収する場 合、100 ng以上のDNAを回収用アガロースゲル電気泳 動に供することが一般的である。ViewaBlue®を用いた 「後染め」と「先染め」では20 ng程度のDNAが確認で きるため、キットを用いた通常のDNA回収法にそのまま 適用できる。従って、ViewaBlue®の試薬としての安全性 や可視光下で作業できる簡便性等を考慮すれば、電気 泳動におけるDNA検出や回収においてViewaBlue®は EtBr染色等の蛍光系染色試薬より使い勝手がよいだろ う。

しかし、蛍光系DNA染色試薬とは異なり、ViewaBlue® を用いたDNA検出には2つの課題がある。1つは、目視 で非常に薄くしか見えないDNAバンドをデジタルカメラ等 で記録することが難しく、露光やシャッタースピードで強度 を上げられる蛍光試薬による染色とは異なる。2点目とし て、一般的な泳動用のローディングダイに含まれる色素で あるブロモフェノールブルーやキシレンシアノールと色調が 干渉することが挙げられる。ViewaBlue®で染色した場 合、これらの色素と標的DNAのバンドとが重なると両者 を区別することができない。そのため、ViewaBlue®用の ローディングダイには色調が異なるオレンジGのみを添加 した別売の6倍濃縮ローディングバッファー オレンジGを 使用することが望ましい。

4. アガロースゲルからの回収効率の比較

アガロースゲルからのDNAの回収効率について、自 然光下で作業できる ViewaBlue®と、UV-C下で行う EtBr 染色、および青色光下で行うSYBR-Safe(インビト ロジェン社)と比較した。前述の制限酵素 EcoRI で切断 した3 µgのpAcGFP-1を電気泳動したゲルをそれぞれ の染色試薬で「後染め」した後(図5)、pAcGFP-1のバ ンドを切り出し、DNA 回収用キットである Wizard Gel and PCR purification system(プロメガ社)を用いて切 り出したアガロースゲルからDNAを回収した。回収 DNA量はどの染色方法を用いても大きな差は見られな かった。現在市販されているDNA 回収用キットは、高濃 度のカオトロピック塩存在下でDNAをシリカメンブレンや シリカビーズに選択的に吸着させるものが主流である。 そのため ViewaBlue®によって DNA のシリカへの吸着 が阻害される可能性も考えられたが、実際にはほとんど 影響しないことが確認された。また、エタノール含有溶液 で洗浄する工程で、DNAに吸着しているViewaBlue® はDNAから遊離して洗い流されたため、UV吸光度測 定や蛍光試薬による回収DNAの濃度検定には影響し なかった。



回収した各々のDNAの一部(25 ng)は、20 µl でライ

図5 アガロースゲルからの目的 DNAの回収。

アガロースゲルに、それぞれ3 μgのEcoRI切断したpAcGFP-1を泳動後、EtBr、SYBR®Safe、ViewaBlue® Stain KANTOで染色後、EtBr染色は紫外線で、 SYBR®Safe はSafe Imager™ blue light transilluminator(インビトロジェン社)と専用フィルターで可視化した。ViewaBlue® Stain KANTO染色したゲルは、ス キャナーで画像を取り込んだ。黒矢印は目的DNA (pAcGFP-1, EcoRI切断済み)を示す。 ゲーション反応を行い、そのうち5 µl (DNA 量で 6.25 ng)を用いて大腸菌を形質転換することにより、回収した DNAの品質を評価することとした。もし回収DNAにピリ ミジンダイマーのような損傷が入っていれば、形質転換さ れて生育できる大腸菌のコロニー数が減少する。EtBr 染色とUV-Cの組み合わせでは、DNAにピリミジンダイ マーが生成することが知られているため、UV-Cは15秒 間と30秒間照射する試験区を設けた。その結果、青色 光照射下で作業を行うSYBR®-Safe 染色と、自然光下 で作業するViewaBlue®染色では、非常に多くの形質 転換された大腸菌コロニーが観察された(図6)。一方、 EtBr染色したゲルから回収したDNAを用いた場合は、 UV-Cの照射時間が長くなるにつれて形質転換体のコ ロニー数が減ることが明らかとなった。以上の結果から、 自然光下で作業できるViewaBlue®染色したアガロース ゲルから回収した DNAを用いたクローニング効率は、 DNA 損傷が生じない SYBR[®]-Safe で染色した場合と 同程度であった。つまりViewaBlue®を用いた場合でも UVを用いないためゲルからの回収時にDNAに損傷が 入らず、その後の実験に適用できることが判明した。



図6回収したDNAの損傷度の比較

pAcGFP-1によって形質転換された大腸菌は蛍光タンパク質であるGFPを 発現するため、GFPを発現した形質転換体のコロニーを可視化した。 SYBR®SafeおよびViewaBlue® Stain KANTOで染色したゲルから回収し たプラスドDNAを用いた場合、非常に多くの形質転換されたコロニーが観察される。一方でEtBr染色後に紫外線照射されたDNAは、照射時間の増 加に伴ってDNAが損傷するため、形質転換体のコロニーの数も減少する。

5. おわりに

EtBr染色したアガロースゲルにUV-Cを照射して移 動度を確認した後にDNAを回収してクローニングを行う と、ピリミジンダイマーの形成により著しく効率が低下す る。また、EtBrは変異原性物質であるため、染色廃液や 観察後のゲル等の廃棄物の処理方法については以前 より議論の対象となっている。ViewaBlue®によるアガロー スゲル染色の利点は、EtBrで認められる上述の課題を 克服できることである。蛍光系染色試薬とは異なり、観 察に特別な機材を必要としない、または滅菌蒸留水で 脱色できる等、利便性が高く一般的な研究室であれば すぐに導入できる。一方、ルーチンで電気泳動像を観察 するには、写真撮影で融通が利く蛍光系染色試薬の方 が優れていると思われる。そのため我々の研究室では、 電気泳動像を撮影する際には蛍光系染色試薬でゲル を染色し、DNA 回収には Viewa Blue®を使っている。特 にアガロースゲルからの DNA 回収は、作業工程の多さ や安全性を考えるとViewaBlue®を使うメリットは大きい。 また、検出条件によっては、EtBrに近い検出感度である 上に利便性や安全性が高いため、大学や高校教育に おける学生実験でも十分活用できる核酸染色試薬であ ろう。

参考文献

- 1) Singer, V. L.; Lawlor, T. E.; Yue, S. Mutat. Res. 1999, 439, 37-47.
- Cariello, N.F.; Keohavong, P.; Sanderson, B.J.; Thilly, W.G. Nucleic Acids Res. 1988, 16, 4157.
- Martineau, C.; Whyte, L.G.; Greer, C.W. J. Microbiol. Methods. 2008, 73, 199-202.
- Flores, N.; Valle, F.; Bolivar, F.; Merino, E. BioTechniques. 1992, 13, 203-205.
- 5) Adkins, S.; Burmeister, M. Anal. Biochem. 1996, 240, 17-23.
- Turgut-Balik, D.; Çelik, V.; Moreton, K.; Brady, R.L. Acta Biol. Hung. 2005, 56, 389-397.
- 7) Raymer, D.M.; Smith, D.E. Electrophoresis. 2007, 28, 746-748.

|最|近|の|ト|ピ|ッ|ク|ス

アルカリ性 Cu CMP 後洗浄液 [CMP-B200シリーズ]

半導体デバイスの高集積化に伴い、配線幅や配線間のピッ チの微細化が進んでいる。また、縦方向にも多層配線化が進ん でおり、一層を平坦に積み上げることによって、より高精細な構造 体を造ることが出来る。半導体デバイス製造プロセスにおいて は、CMP(Chemical Mechanical Polishing:化学的機械研磨)で ウェハ表面の平坦化を行っている。CMPは、スラリーに含まれる 研磨砥粒(シリカ、セリア等)の機械的効果と薬液成分(酸化剤、 防食剤等)の化学的効果との相乗効果により、ウェハ表面を平 坦化する技術である。CMP後のウェハ表面は、パーティクル(スラ リー中の砥粒、防食剤と配線材料の錯体由来の有機系残渣 等)や金属不純物(スラリー、配線材料由来)で汚染されている ため、ブラシスクラブと薬液を併用した洗浄を行う。この時に使用 される薬液は、"CMP後洗浄液"と呼ばれ、高いパーティクル洗 浄性能、金属不純物洗浄性能、配線材料へのダメージ抑制な どの機能が要求される。関東化学で新たに開発したアルカリ性 のCu CMP後洗浄液「CMP-B200シリーズ」について紹介する。

1. [CMP-B200シリーズ]の製品ラインナップと特徴

1-1) 製品ラインナップ

口々	成分 pH(100倍		推奨希釈	供求		
	塩基性化合物	その他	希釈時)	倍率	ш <i>1</i> 5	
CMP-B201	ち機フルカリ	七日、「文川	9	100~	・基本組成	
CMP-B202		イレート剤	8	200	・ポーラスlow-k材料に対応	
CMP-B203	有機アルカリ	キレート剤	11	100	・高い有機残渣除去性	
CMP-B204		添加剤	11	100	ガルバニック腐食抑制が可能	



パーティクルサイズ: 0.17µm↑

- 図1 パーティクル除去性評価結果
- ・ウェハ:Cu/Si ウェハ
- ●評価プロセス:Cu CMP→バリアメタル CMP→洗浄→乾燥 ●洗浄液:CMP-B203(100倍希釈品)、従来品(アルカリ系)



CMP-B203



図3 Cu/Coの接液面積比におけるガルバニック電流

1-2)特徴

- ① CMP後のパーティクル(砥粒、有機残渣)、金属不純物汚 染の除去性が高く、B203およびB204は、特に有機残渣除 **夫性に優れる**
- 金属(Cu、Ti、Ta等)および層間絶縁膜(SiO2、low-k等)をア タックせず、Cuと新規バリアメタル(Co、Ruなど)とのガルバ ニック腐食を抑制可能
- ③ 処理後のCu表面を安定に維持可能(酸化の進行を抑制)
- ④高い希釈倍率(100倍以上)により、洗浄プロセスの低コスト 化が可能
- ⑤ 危険性、有害性が低い(TMAHフリー等)

2. 性能

従来品(アルカリ系)

2-1)パーティクル除去性評価結果

Cuブランケットウェハにおけるパーティクル除去性評価結果を 図1に示す。B203は従来品よりも、良好な洗浄結果が得られて いる。

2-2)洗浄後のCu表面状態確認結果

AFMによる洗浄後のCu表面状態の確認結果を図2に示す。 B203は従来品よりも、Cuに対するダメージが小さく、Cu/TaN構 造ウェハにおけるガルバニック腐食が小さいことが解る。

2-3)Cu/Coの接液面積比におけるガルバニック電流

次世代のバリアメタル材料として候補に挙がっているCoやRu

を用いたプロセスへの適用も進めている。 各種CMP後洗浄液における、Coエリアを 1cm²にセットしたターフェルプロットからガル バニック電流を算出した結果を図3に示す。 Cu/Co面積比10の場合は、酸系やアルカリ 系の従来品①~③と比較し、B203および B204は特にガルバニック電流が小さくなるた め、Cu/Coバリア構造などの次世代デバイス への適用が期待される。

3. まとめ

CMP-B203、CMP-B204は、Cu-BTA錯 体などの有機系残渣の除去性の向上、Cu へのダメージを低減できることから、洗浄後 のウェハ表面の欠陥数を大幅に低減するこ とができると考える。更に次世代バリアメタル 材料として注目されているCoやRuを用いた プロセスへの適用も期待できる。また、各特 殊基板へ対応できる組成提案・開発も可能 である。今後も環境・安全面、コスト面への 配慮を行いつつ、シリーズ拡充を行う。

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 室町東三井ビルディング **Czzz** 関東化学株式会社 電話 (03)6214-1056 FAX (03)3241-1029 インターネットホームページ http://www.kanto.co.jp 編集責任者 金田 尚 平成25年10月1日 発行